

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

22. 12. 2004



REC'D 24 JAN 2005

WIPO

PCT

**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung
einer Patentanmeldung****Aktenzeichen:**

103 57 580.4

Anmeldetag:

08. Dezember 2003

Anmelder/Inhaber:Heraeus Quarzglas GmbH & Co KG,
63450 Hanau/DE**Bezeichnung:**Verfahren zur Herstellung von laseraktivem Quarz-
glas und Verwendung desselben**IPC:**

C 03 B 8/02

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ur-
sprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 14. Dezember 2004
Deutsches Patent- und Markenamt

Der Präsident

Im Auftrag

Faust

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

Patentanmeldung**Heraeus Quarzglas GmbH & Co. KG****Verfahren zur Herstellung von laseraktivem Quarzglas und
Verwendung desselben**

5

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von laseraktivem Quarzglas. Laseraktives Quarzglas wird beispielsweise eingesetzt für die Herstellung von Faserverstärkern oder von Faserlasern. Gepumpte Faserlaser werden für die Materialbearbeitung und in der Medizintechnik verwendet.

10

Laseraktives Quarzglas enthält Dotierstoffe, die eine Verstärkung von Laserstrahlung im Wirtsmaterial Quarzglas bewirken. Dabei handelt es sich in der Regel um Seltenerd-Kationen (Lanthaniden), aber auch um Kationen der sogenannten Übergangsmetalle. Dabei kommt es auf eine möglichst geringe Dämpfung der zu übertragenden und zu verstärkenden Laserstrahlung an.

15

In dem Zusammenhang stellen sich grundsätzlich die Aufgaben, eine möglichst homogene Verteilung der Dotierstoffe im Quarzglas zu gewährleisten, und eine Entglasung, wie sie insbesondere bei hohen Dotierstoffkonzentrationen auftreten kann, zu vermeiden. Bei Faserlasern für den Hochleistungsbereich liegt ein besonderes Augenmerk auch darauf, ein möglichst großes laseraktives Volumen bereit stellen zu können.

20

Optische Fasern werden in der Regel aus Vorformen gezogen, welche einen Kernbereich aufweisen, der aus dem laseraktiven Material besteht, und der von einem Mantelglasbereich umhüllt ist. Da die Fasern eine ausreichend niedrige Dämpfung aufweisen müssen, werden für die Herstellung der Vorformen in aller Regel CVD-Verfahren oder Sol-Gel-Verfahren eingesetzt, welche eine hohe Reinheit gewährleisten. Gegenwärtig werden Hochleistungs-Laserfasern aus Quarzglasbasis überwiegend nach dem sogenannten MCVD-Verfahren (Modified Chemical Vapor Deposition) hergestellt. Dieses Verfahren ist jedoch kostenaufwändig und es stößt hinsichtlich der machbaren Faserabmessungen mittlerweile an Grenzen.

25

30

Herstellungsverfahren basierend auf dem Sol-Gel-Prozess benötigen teilweise lange Prozesszeiten und führen häufig nicht zu den erforderlichen Materialqualitäten. Mittels Schmelzverfahren ist die erforderliche hohe Reinheit nicht zu erreichen.

- 5 Es ist daher Ziel der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren zur Herstellung von laseraktivem Quarzglas anzugeben, das wirtschaftlich ist, und das es ermöglicht, ein laseraktives Volumen aus dotiertem Quarzglas in nahezu beliebiger Form und Abmessung bereit zu stellen.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein Verfahren gelöst, das die folgenden Verfahrensschritte aufweist:

- 10
- a) Bereitstellen einer thixotropen Dispersion mit einem Feststoffgehalt von mindestens 40 Gew.-%, die SiO_2 -Nanopulver sowie Dotierstoffe in einer Flüssigkeit enthält,
 - 15 b) Granulation durch Bewegen der Dispersion unter Entzug von Feuchtigkeit bis zur Bildung eines dotierten SiO_2 -Granulats aus sphärischen, porösen Granulatkörnern mit einem Feuchtigkeitsgehalt von weniger als 45 Gew.-% und mit einer Dichte von mindestens 1 g/cm^3 ,
 - c) Trocknen und Reinigen des SiO_2 -Granulats durch Aufheizen auf eine Temperatur von mindestens 1000°C unter Bildung einer dotierten, porösen SiO_2 -Körnung mit einem OH-Gehalt von weniger als 10 ppm; und
 - d) Sintern oder Erschmelzen der dotierten SiO_2 -Körnung unter Bildung des Rohlings aus dotiertem Quarzglas.

25 Die Herstellung des Rohlings für ein Bauteil aus laseraktivem Quarzglas erfolgt erfindungsgemäß weder über ein CVD- noch ein Schmelz oder Sol-Gel-Verfahren, sondern über eine „Pulver-Route“, und zwar unter Einsatz eines hochreinen homogen dotierten SiO_2 -Granulats. Es hat sich gezeigt, dass über diese „Granulat-Pulver-Route“ einerseits die Anforderungen hinsichtlich der Reinheit der Ausgangsmaterialien erfüllbar sind, und dass andererseits die erforderliche homogene

Verteilung des Dotierstoffes oder der Dotierstoffe in dem Quarzglas gewährleistet werden kann.

Hierzu wird zunächst ein SiO_2 -Granulat hergestellt, das mit dem Dotierstoff homogen dotiert ist. In der DE 197 29 505 A1 ist ein Verfahren zur Herstellung eines
5 undotierten SiO_2 -Granulats beschrieben, das grundsätzlich auch für die Herstellung von dotiertem Granulat geeignet ist. Eine wesentliche Modifizierung des bekannten Verfahrens zur Granulatherstellung besteht darin, dass die Dispersion mindestens einen Teil der erforderlichen Dotierstoffe enthält. Bei dem Dotierstoff, welcher die Laseraktivität des Quarzglases bewirkt, handelt es sich um ein Kation
10 oder mehrere Kationen der Seltenerd- und der Übergangsmetalle. Außerdem sind weitere Dotierstoffe zur Einstellung der Viskosität und des Brechungsindex des Quarzglases vorgesehen, wofür in erster Linie eine oder mehrere Komponenten aus der Gruppe bestehend aus Aluminium, Phosphor und Bor eingesetzt werden.

Das für die Herstellung der Dispersion eingesetzte SiO_2 -Pulver liegt als sogenanntes Nano-Pulver vor. Dabei handelt es sich um Pulverteilchen mit einer Teilchengröße unterhalb von 100 nm, welche zum Beispiel durch Pyrolyse von SiO_2 -Ausgangsverbindungen, durch Fällungsreaktionen oder durch Aufmahlen verglaster SiO_2 -Körnung erhalten werden können. Dieses feindisperse Nanopulver ermöglicht die erforderliche homogen Verteilung der Dotierstoffe in dem Quarzglas.
15

Erfindungsgemäß werden die Dotierstoffe in der Dispersion homogen verteilt. Die Dotierstoffe liegen ebenfalls als feinteiliges Pulver oder in Form einer Flüssigkeit vor.
20

Im Hinblick auf eine wirtschaftliche Verfahrensweise und einen möglichst hohen Feststoffgehalt des SiO_2 -Granulats liegt der anfängliche Feststoffgehalt der Dispersion bei mindestens 40 Gew.-%. Der pH-Wert der Dispersion wird im Bereich
25 pH 0 bis 7 eingestellt, bevorzugt liegt der pH-Wert zwischen 1 und 5.

Die Granulation wird dadurch bewirkt, dass der Dispersion unter fortwährender Bewegung so lange Feuchtigkeit entzogen wird, bis sie eine krümelige Masse – ein Granulat - bildet. Die Bewegung erfolgt im Allgemeinen durch Rühren, wie dies
30 in der DE 197 29 505 A1 beschrieben ist, Wichtig ist, dass die Dispersion erst

dann in eine krümelige Masse zerfällt, wenn sie einen hohen Feststoffgehalt aufweist. Die flüssige Phase der Dispersion soll daher möglichst lange aufrechterhalten werden, was bei einer thixotropen Dispersion durch eine Bewegung unter hohem Energieeintrag gewährleistet werden kann. Hierfür geeignete Granulationsverfahren ist die Rollgranulation in einem Granulierteller, die Sprühgranulation, die Zentrifugalzerstäubung und die Wirbelschichtgranulation. Andere Granulierungsverfahren unter Einsatz einer Granuliermühle, durch Kompaktierung, Walzenpressen, Brikettierung oder Extrudierung sind jedoch nicht ausgeschlossen.

Wesentlich ist, dass das erhaltene SiO_2 -Granulat aus porösen SiO_2 -Granulatkörnern besteht, die eine sphärische Form haben, und deren Feuchtigkeitsgehalt weniger als 35 Gew.-% und deren Dichte mindestens 1 g/cm^3 beträgt. Erst durch die hohe Dichte des SiO_2 -Granulats und den hohen Feststoffgehalt kann eine geringe Schrumpfung und ein blasenfreies Einschmelzen bzw. Sintern gewährleistet werden.

Das so erhaltene, poröse Granulat wird in einem weiteren Verfahrensschritt getrocknet und gereinigt, indem es auf eine Temperatur von mindestens 1000°C unter Bildung einer porösen SiO_2 -Körnung aufgeheizt wird. Hierbei kommt es zu einer thermischen Verfestigung des Granulats unter Beibehaltung von Porosität.

Im Hinblick auf eine Blasenbildung beim anschließenden Verglasen und einer Beeinträchtigung der optischen Eigenschaften des Quarzglases durch Absorption ist es wichtig, dass die SiO_2 -Körnung einen OH-Gehalt von weniger als 10 Gew.-ppm aufweist. Wegen seiner Rest-Porosität kann das SiO_2 -Granulat vor, während und nach dem Verfahrensschritt c), dem Trocknen und Reinigen, zusätzlich mit Dotierstoffen versehen werden. Diese Dotierung kann über die Gasphase oder über die Flüssigphase erfolgen.

Wesentlich ist, dass die Dotierstoffe in der SiO_2 -Körnung homogen verteilt vorliegen und darin fest gebunden sind. Hierzu ist es in der Regel erforderlich, solche Dotierstoffe, die bei hoher Temperatur flüchtige Verbindungen bilden, können, in feste Oxide zu überführen, was bevorzugt im Verlauf der Verfahrensschritte a) bis c) geschieht.

Die so erhaltene SiO_2 -Körnung ist homogen mit dem laseraktiven Dotierstoff dotiert und wird anschließend unter Bildung des Quarzglas-Rohlings gesintert bzw. erschmolzen. Es hat sich gezeigt, dass es gelingt es, ein blasenfreies, homogen dotiertes Quarzglas zu erhalten, wenn das eingesetzte SiO_2 -Granulat (und damit
5 auch die daraus erhaltene SiO_2 -Körnung) eine hohen Dichte und gleichzeitig einen geringen OH-Gehalt aufweist.

Das erfindungsgemäße Verfahren stellt ein flexibles und wirtschaftliches Herstellungsverfahren dar, das aufgrund der "Pulver-Route" und modular anhand der Verfahrensschritte a) bis d) eine maßgeschneiderte Produkt-Prozessierung
10 gewährleistet, wobei unterschiedlichste Dotierstoffkonzentrationen erhalten werden können.

Im Hinblick auf eine hohe Dichte des SiO_2 -Granulats und einer damit einhergehenden homogenen Dotierstoffverteilung und einer geringen Blasendichte des herzustellenden Quarzglases wird eine Verfahrensweise bevorzugt, bei der in der
15 Dispersion ein anfänglicher Feststoffgehalt von mindestens 50 % eingestellt wird.

Für eine geringe Blasendichte ist es auch vorteilhaft, wenn das nach Verfahrensschritt b) erhaltene SiO_2 -Granulat einen Feuchtigkeitsgehalt von maximal 35 Gew.-% aufweist.

Dabei hat es sich auch als günstig erwiesen, wenn das nach Verfahrensschritt b) erhaltene SiO_2 -Granulat eine BET-Oberfläche im Bereich zwischen 40 m^2/g bis 70
20 m^2/g aufweist. Vorzugsweise liegt die BET-Oberfläche nach Verfahrensschritt b) bei dem SiO_2 -Granulat bei mindestens 50 m^2/g . Hierdurch wird beim Sintern bzw. Schmelzen des SiO_2 -Granulats eine geringe Blasenbildung erreicht.

In dem Zusammenhang ist es auch vorteilhaft, wenn das nach Verfahrensschritt b) erhaltene SiO_2 -Granulat eine Dichte von mindestens 1,1 g/cm^3 aufweist.
25

Im Hinblick auf ein günstiges Sinter- bzw. Schmelzverfahren hat es sich als vorteilhaft erwiesen, wenn die sphärischen, porösen Granulatkörner eine Korngröße von weniger als 500 μm aufweisen.

Ein besonders effektives und rasches Trocknen der porösen SiO_2 -Granulatkörner wird erreicht, wenn das SiO_2 -Granulat in chlorhaltiger Atmosphäre getrocknet und gereinigt wird. Dabei hat es sich besonders bewährt, wenn das SiO_2 -Granulat bei einer Temperatur von mindestens 1050°C getrocknet und gereinigt wird.

- 5 Vorteilhafterweise erfolgt das Trocknen und Reinigen des porösen Granulats unter sauerstoffhaltiger Atmosphäre. Dadurch wird eine Fixierung solcher Dotierstoffe bewirkt, welche beim Aufheizen auf höhere Temperaturen flüchtige Verbindungen bilden können.

- 10 Es hat sich weiterhin als vorteilhaft erwiesen, wenn die nach Verfahrensschritt c) erhaltene poröse SiO_2 -Körnung einen OH-Gehalt von weniger als 1 Gew.-ppm aufweist. Der geringe OH-Gehalt wirkt sich vorteilhaft sowohl auf die Blasenbildung als auch auf die optische Dämpfung des Quarzglas bei den durch die OH-Absorption beeinflussten Lichtwellenlängen aus.

- 15 Im Hinblick auf eine geringe Blasenbildung hat es sich auch als günstig erwiesen, wenn die nach Verfahrensschritt c) erhaltene poröse SiO_2 -Körnung eine BET-Oberfläche von weniger als $20\text{ m}^2/\text{g}$ aufweist.

- 20 Es wird eine Verfahrensweise besonders bevorzugt, bei der das Sintern oder Schmelzen der SiO_2 -Körnung nach Verfahrensschritt d) ein Gasdrucksintern umfasst. Beim Gasdrucksintern wird die zu sinternde SiO_2 -Körnung unter erhöhtem Druck erhitzt und dabei erschmolzen. Der Überdruck reduziert die Blasenbildung.

Besonders bewährt hat sich eine Verfahrensvariante des Gasdrucksinterns, das folgende Verfahrensschritte umfasst:

- 25 aa) ein Aufheizen der SiO_2 -Körnung auf eine Schmelztemperatur von mindestens 1600°C unter Anlegen und Aufrechterhalten eines Unterdruck,
- bb) ein Halten bei der Schmelztemperatur unter einem Überdruck im Bereich zwischen 5 bar und 15 bar während einer Schmelzdauer von mindestens 30 min unter Bildung des Quarzglas-Rohlings,
- cc) ein Abkühlen des Quarzglas-Rohlings.

Mit dieser Verfahrensvariante gelingt es insbesondere auch große Formteile in optisch einwandfreier Qualität herzustellen.

- Als besonders günstig hat es sich erwiesen, wenn das Abkühlen nach Verfahrensschritt cc) unter Aufrechterhaltung eines Überdrucks erfolgt. Durch das Aufrechterhalten des Überdrucks während des Abkühlens wird eine Ausbildung und das Wachstum von Blasen im noch erweichten Quarzglas vermieden.

- 10 Besonders bewährt hat sich eine Verfahrensmodifikation, bei der die SiO_2 -Körnung vor dem Verfahrensschritt d) thermisch verdichtet wird. Auch die Vorverdichtung der SiO_2 -Körnung trägt zu einer Verminderung der Blasenbildung während der Schmelz- bzw. Sinterphase bei.

Es hat sich bewährt, wenn der Quarzglas-Rohling bei einer Temperatur von mindestens 1120 °C während einer Haltezeit von mindestens 40 h getempert wird. Hierdurch werden thermische Spannungen, welche eine Doppelbrechung bewirken, abgebaut.

- 15 Bei einer besonders bevorzugten Verfahrensvariante wird die SiO_2 -Körnung nach Verfahrensschritt d) in einer Form erschmolzen. Infolge der hohen Dichte der SiO_2 -Körnung und der damit einhergehenden geringen Schrumpfung des daraus gesinterten Formkörpers weist dieser im Wesentlichen die durch die Form vorgegebenen Abmessungen auf. Nachbearbeitungen können somit vermieden und Materialverluste reduziert werden, was die Wirtschaftlichkeit des Verfahrens weiter verbessert.

- 25 Es hat sich auch als günstig erwiesen, wenn das Sintern oder Erschmelzen nach Verfahrensschritt d) in einer reduzierend wirkenden Atmosphäre erfolgt. Eine reduzierend wirkende Atmosphäre ergibt sich beispielsweise durch Einsatz von Tiegel- oder Ofenteilen aus Grafit oder Kohlenstoff. Durch die reduzierend wirkende Atmosphäre kann die Ausbildung von sauerstoffhaltigen Gasblasen in dem Quarzglas des SiO_2 -Rohlings weiter vermindert werden.

Der SiO_2 -Rohling nach Verfahrensschritt d) wird vorzugsweise dreidimensional homogenisiert. Die Homogenisierung erfolgt durch Verdrillen des SiO_2 -Rohlings in

mehreren Richtungen. Dadurch wird Schlierenfreiheit und eine in drei Dimensionen homogene Verteilung der Brechzahl erreicht.

Alternativ hierzu hat es sich auch als günstig erwiesen, aus SiO_2 -Körnung unterschiedlicher Brechzahl einen Schüttkörper mit einer radial inhomogenen Brechzahlverteilung auszubilden, und diesen Schüttkörper zu dem SiO_2 -Rohling zu sintern oder zu erschmelzen. Durch eine entsprechende Anordnung von SiO_2 -Körnungen unterschiedlicher Brechzahl in einem Schüttkörper lassen sich beliebige Brechzahlverteilungen im gesinterten Quarzglas-Rohling realisieren.

Das erfindungsgemäße Verfahren ist besonders geeignet zur Herstellung von SiO_2 -Rohlingen, welche als Kernmaterial für Faserlaser, als optischer Filter oder als Umhüllungsrohre für Laser Verwendung finden. Derartige Umhüllungsrohre für Laser werden als Kühlrohre zur Einleitung einer Kühlflüssigkeit eingesetzt. Bei den Faserlasern handelt es sich um seitlich gepumpte bzw. um endgepumpte Faserlaser.

Nachfolgend wird die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen näher erläutert:

1. Beispiel: Yb-dotiertes Quarzglas

Es wird ein Stab mit einem Durchmesser von 6 mm aus laseraktivem Quarzglas hergestellt, das mit 0,7 mol-% Yb_2O_3 und mit 5,0 mol-% Al_2O_3 dotiert ist.

Hierzu wird aus Wasser und aus amorphen, nanoskaligen, durch Flammenhydrolyse von SiCl_4 erzeugten, pyrogenen SiO_2 -Partikeln, die eine spezifische Oberfläche (nach BET) von $50 \text{ m}^2/\text{g}$ aufweisen eine wässrige Dispersion hergestellt und homogenisiert. In die homogene Dispersion werden als Ausgangskomponenten für die Dotanden in Wasser lösliche Hydratverbindungen eingesetzt. In 1500 g Wasser werden 1000 g SiO_2 und Dotanden in folgenden Mengen eingerührt:

$\text{YbCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$: 87g

$\text{AlCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$: 387g

Die Herstellung des Granulats erfolgt mittels eines üblichen Naßgranulativverfahrens unter Einsatz eines Eirich-Mischers. Hierzu wird der Dispersion durch Über-

leiten von erwärmter Luft und unter fortwährendem Rühren Feuchtigkeit entzogen, bis diese unter Bildung einer krümeligen Masse aus sphärischen, porösen, homogen dotierten SiO_2 -Granulatkörnern zerfällt.

Die SiO_2 -Granulatkörner zeichnen sich durch einen geringen Feuchtigkeitsgehalt von 28 Gew.-% und durch eine Dichte von $1,05 \text{ g/cm}^3$ aus.

Sie werden anschließend durch Erhitzen in einem Durchlaufofen bei einer Temperatur von ca. 1200°C in chlorhaltiger Atmosphäre gereinigt und getrocknet und gleichzeitig thermisch leicht vorverdichtet. Die Reinigung mittels Chlor ist dabei besonders effektiv, da die Oberfläche der SiO_2 -Partikel über die Porenkanäle für das Reinigungsgas zugänglich ist und die gasförmigen Verunreinigungen leicht entfernt werden können.

Die nach dieser Vorbehandlung erhaltene SiO_2 -Körnung zeichnet sich durch einen OH-Gehalt von weniger als 1 Gew.-ppm, eine spezifische BET-Oberfläche von $34 \text{ m}^2/\text{g}$ und durch eine Stampfdichte von $1,1 \text{ g/cm}^3$ aus. Der mittlere Korndurchmesser liegt bei etwa $420 \mu\text{m}$, wobei die Fraktion mit Korngrößen oberhalb von $500 \mu\text{m}$ vor dem Sintern entfernt wird. Der Gesamtgehalt der Verunreinigungen an Li, Na, K, Mg, Ca, Fe, Cu, und Mn beträgt weniger als 200 Gew.-ppb.

Die so hergestellte dotierte, poröse SiO_2 -Körnung aus amorphen, nanoskaligen SiO_2 -Partikeln wird anschließend in eine Grafitform gegeben und bei einer Temperatur von 1600°C durch Gasdrucksintern verglast. Hierbei wird die Form zunächst unter Aufrechterhaltung eines Unterdrucks von auf die Sintertemperatur von 1600°C aufgeheizt. Nach Erreichen der Sintertemperatur wird im Ofen ein Überdruck von 5 bar eingestellt und die Form bei dieser Temperatur ca. 30 min lang gehalten. Beim anschließenden Abkühlen auf Raumtemperatur wird der Überdruck bis zu einer Temperatur von 400°C noch weiter aufrecht erhalten.

Das so erhaltene Yb-dotierte Quarzglasblock ist transparent, gelblich gefärbt und von ausgezeichneter optischer Qualität. Das Quarzglas ist als Kernglas für einen optisch gepumpten Faserlaser geeignet. Kernstäbe bis zu einem Durchmesser von 15 mm können aus dem Blockmaterial durch Kernbohren entnommen werden.

Die so erzeugten Hohlzylinder finden als laseraktive Kühlrohre bei Lasern Verwendung.

2. Beispiel: Nd-dotiertes Quarzglas

- 5 Es wird ein Stab mit einem Durchmesser von 10 mm und einer Länge von 1 m aus laseraktivem Quarzglas hergestellt, das mit 1300 ppm Nd_2O_3 , und 0,5 mol % Al_2O_3 , dotiert ist.

10 Hierzu wird aus Wasser und aus amorphen, nanoskaligen, durch eine Sol-Gel-Fällungsreaktion erzeugten SiO_2 -Partikeln, die eine spezifische Oberfläche (nach BET) von $50 \text{ m}^2/\text{g}$ aufweisen eine wässrige Dispersion mit einem anfänglichen Feststoffgehalt von 50 Gew.-% hergestellt und homogenisiert. In die homogene Dispersion werden als Ausgangskomponenten für die Dotanden in Wasser lösliche Hydratverbindungen eingesetzt. Pro kg SiO_2 werden 40,0g $\text{AlCl}_3 \times 6\text{H}_2\text{O}$ und 2,8g $\text{NdCl}_3 \times 6\text{H}_2\text{O}$ in die Dispersion eingerührt.

- 15 Die Herstellung des Granulats erfolgt wie anhand Beispiel 1 beschrieben. Es stellen sich infolgedessen auch die gleichen Eigenschaften der so erhaltenen SiO_2 -Granulatkörner ein.

20 Das dotierte Granulat wird anschließend durch Erhitzen in einem Durchlaufofen bei einer Temperatur von ca. 1250°C in chlor- und sauerstoffhaltiger Atmosphäre gereinigt und getrocknet und gleichzeitig thermisch leicht vorverdichtet. Die nach dieser Vorbehandlung erhaltene SiO_2 -Körnung zeichnet sich durch einen OH-Gehalt von weniger als 1 Gew.-ppm, und durch eine spezifische BET-Oberfläche von $18 \text{ m}^2/\text{g}$ aus.

- 25 Die Kornfraktion mit Korngrößen oberhalb von $500 \mu\text{m}$ wird entfernt, und die verbleibende Körnung wird durch kurzes Erhitzen auf eine Temperatur um 1450°C dichtgesintert. Die auf diese Weise erhaltene dichte SiO_2 -Körnung zeichnet sich durch einen OH-Gehalt von weniger als 1 Gew.-ppm aus. Der Gesamtgehalt der Verunreinigungen an Li, Na, K, Mg, Ca, Fe, Cu, und Mn beträgt weniger als 200 Gew.-ppb.

Die so hergestellte dotierte, poröse SiO_2 -Körnung wird anschließend in eine Grafitform gegeben und bei einer Temperatur von 1600 °C durch Gasdrucksintern verglast, wie dies oben anhand Beispiel 1 beschrieben ist.

Das so erhaltene Nd-dotierte Quarzglasblock ist transparent und von ausgezeichnete
5 neter optischer Qualität und ist für einen Einsatz als Kernmaterial für einen Faserlaser oder als optischer Filter geeignet. Durch Kernbohren werden aus dem Blockmaterial daraus Rohre hergestellt, die als laseraktive Kühlrohre bei Lasern Verwendung finden.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines Rohlings für ein Bauteil aus laseraktivem Quarzglas, umfassend die folgenden Verfahrensschritte:
 - a) Bereitstellen einer thixotropen Dispersion mit einem Feststoffgehalt von mindestens 40 Gew.-%, die SiO_2 -Nanopulver sowie Dotierstoffe in einer Flüssigkeit enthält,
 - b) Granulation durch Bewegen der Dispersion unter Entzug von Feuchtigkeit bis zur Bildung eines dotierten SiO_2 -Granulats aus sphärischen, porösen Granulatkörnern mit einem Feuchtigkeitsgehalt von weniger als 35 Gew.-% und mit einer Dichte von mindestens 1 g/cm^3 ,
 - c) Trocknen und Reinigen des SiO_2 -Granulats durch Aufheizen auf eine Temperatur von mindestens 1000°C unter Bildung einer dotierten, porösen SiO_2 -Körnung mit einem OH-Gehalt von weniger als 10 ppm; und
 - d) Sintern oder Erschmelzen der dotierten SiO_2 -Körnung unter Bildung des Rohlings aus dotiertem Quarzglas
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass in der Dispersion ein anfänglicher Feststoffgehalt der von mindestens 60 % eingestellt wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das nach Verfahrensschritt b) erhaltene SiO_2 -Granulat einen Feuchtigkeitsgehalt von maximal 35 Gew.-% aufweist.
4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das nach Verfahrensschritt b) erhaltene SiO_2 -Granulat eine BET-Oberfläche im Bereich zwischen $40 \text{ m}^2/\text{g}$ bis $70 \text{ m}^2/\text{g}$ aufweist.
5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass das nach Verfahrensschritt b) erhaltene SiO_2 -Granulat eine BET-Oberfläche von mindestens $50 \text{ m}^2/\text{g}$ aufweist.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das nach Verfahrensschritt b) erhaltene SiO_2 -Granulat eine Dichte von mindestens $1,1 \text{ g/cm}^3$ aufweist.
- 5 7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die sphärischen, porösen Granulatkörner eine Korngröße von weniger als $500 \mu\text{m}$ aufweisen.
8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das SiO_2 -Granulat in chlorhaltiger Atmosphäre getrocknet und gereinigt wird.
- 10 9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das SiO_2 -Granulat bei einer Temperatur von mindestens 1050°C getrocknet und gereinigt wird.
- 15 10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Trocknen und Reinigen des porösen Granulats unter sauerstoffhaltiger Atmosphäre erfolgt.
11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die nach Verfahrensschritt c) erhaltene poröse SiO_2 -Körnung einen OH-Gehalt von weniger als ein Gew.-ppm aufweist.
12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die nach Verfahrensschritt c) erhaltene poröse SiO_2 -Körnung eine BET-Oberfläche von weniger als $20 \text{ m}^2/\text{g}$ aufweist.
13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Sintern oder Schmelzen der SiO_2 -Körnung nach Verfahrensschritt d) ein Gasdrucksintern umfasst.
- 25 14. Verfahren nach Anspruch 13, dass das Gasdrucksintern folgende Verfahrensschritte umfasst:
 - aa) ein Aufheizen der SiO_2 -Körnung auf eine Schmelztemperatur von mindestens 1600°C unter Anlegen und Aufrechterhalten eines Unterdruck,

bb) ein Halten bei der Schmelztemperatur unter einem Überdruck im Bereich zwischen 5 bar und 15 bar während einer Schmelzdauer von mindestens 30 min unter Bildung des Quarzglas-Rohlings,

cc) ein Abkühlen des Quarzglas-Rohlings.

5 15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass das Abkühlen nach Verfahrensschritt cc) unter Aufrechterhaltung eines Überdrucks erfolgt.

10 16. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die SiO_2 -Körnung vor dem Verfahrensschritt d) thermisch verdichtet wird.

17. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Quarzglas-Rohling bei einer Temperatur von mindestens 1120°C während einer Haltezeit von mindestens 40 h getempert wird.

15 18. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die SiO_2 -Körnung nach Verfahrensschritt d) in einer Form erschmolzen wird.

19. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Sintern und Erschmelzen nach Verfahrensschritt d) in einer reduzierend wirkenden Atmosphäre erfolgt.

20 20. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der SiO_2 -Rohling nach Verfahrensschritt d) dreidimensional homogenisiert wird.

25 21. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass SiO_2 -Körnung unterschiedlicher Brechzahl ein Schüttkörper mit einer radial inhomogenen Brechzahlverteilung gebildet wird, und dass der Schüttkörper zu dem SiO_2 -Rohling gesintert oder erschmolzen wird.

- 15 -

22. Verwendung eines nach einem Verfahren gemäß den Ansprüchen 1 bis 21 erhalten SiO_2 -Rohlings als Kernmaterial für einen Faserlaser, als optischer Filter oder als Umhüllungsrohr für Laser.

Zusammenfassung

Verfahren zur Herstellung von laseraktivem Quarzglas und Verwendung desselben

5

Es wird ein Verfahren angegeben, das die wirtschaftliche Herstellung eines Rohlings für ein Bauteil aus laseraktivem Quarzglas in beliebiger Form und Abmessung ermöglicht. Das Verfahren umfasst die folgenden Verfahrensschritte:

- 10 a) Bereitstellen einer thixotropen Dispersion mit einem Feststoffgehalt von mindestens 40 Gew.-%, die SiO_2 -Nanopulver sowie Dotierstoffe in einer Flüssigkeit enthält,
- b) Granulation durch Bewegen der Dispersion unter Entzug von Feuchtigkeit bis zur Bildung eines dotierten SiO_2 -Granulats aus sphärischen, porösen Granulatkörnern mit einem Feuchtigkeitsgehalt von weniger als 35 Gew.-% und mit einer Dichte von mindestens 1 g/cm^3 ,
15
- c) Trocknen und Reinigen des SiO_2 -Granulats durch Aufheizen auf eine Temperatur von mindestens 1000°C unter Bildung einer dotierten, porösen SiO_2 -Körnung mit einem OH-Gehalt von weniger als 10 ppm; und
- d) Sintern oder Erschmelzen der dotierten SiO_2 -Körnung unter Bildung des Rohlings aus dotiertem Quarzglas